

Установки электронно-лучевого напыления EB-450 и E-400L



Производитель:

ЦУНВ

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установка электронно-лучевого напыления EB-450 специально разработана для мелко- и среднесерийных производств. Установка позволяет получать тонкие пленки широкого спектра металлов (Al, Au, Cr, Cu, Vn, Ni, Ti и др.), диэлектриков и полупроводниковых материалов. Установка может быть легко сконфигурирована под требуемые задачи при работе с пластинами 60 x 48 мм или 2" - 8", обеспечивает хорошую повторяемость результатов при осаждении одно- и многослойных пленок. Равномерность нанесения материалов типично составляет $\leq 3\%$. Компактный корпус машины может быть легко размещен в условиях недостатка площадей, конструкция корпуса позволяет разместить установку через стену ЧПП.

В отличие от однокамерной конфигурации в установке EB-450, установка E-400-L выполняется в двухкамерной конфигурации. Нижняя камера выполняет функцию изоляции электронно-лучевого испарителя, а верхняя камера используется для загрузки образцов. Таким образом, материал для испарения всегда остается в вакуумной камере даже в процессе загрузки образцов. Размер верхней камеры может изменяться в зависимости от размера и количества подложек. Верхняя и нижняя камеры разделены высоковакуумным шибером.

Обе установки опционально оснащаются различными типами насосов, ИК-нагревателями, ионным источником для очистки или ассистирования. Возможно исполнение установок с вакуумным шлюзом.